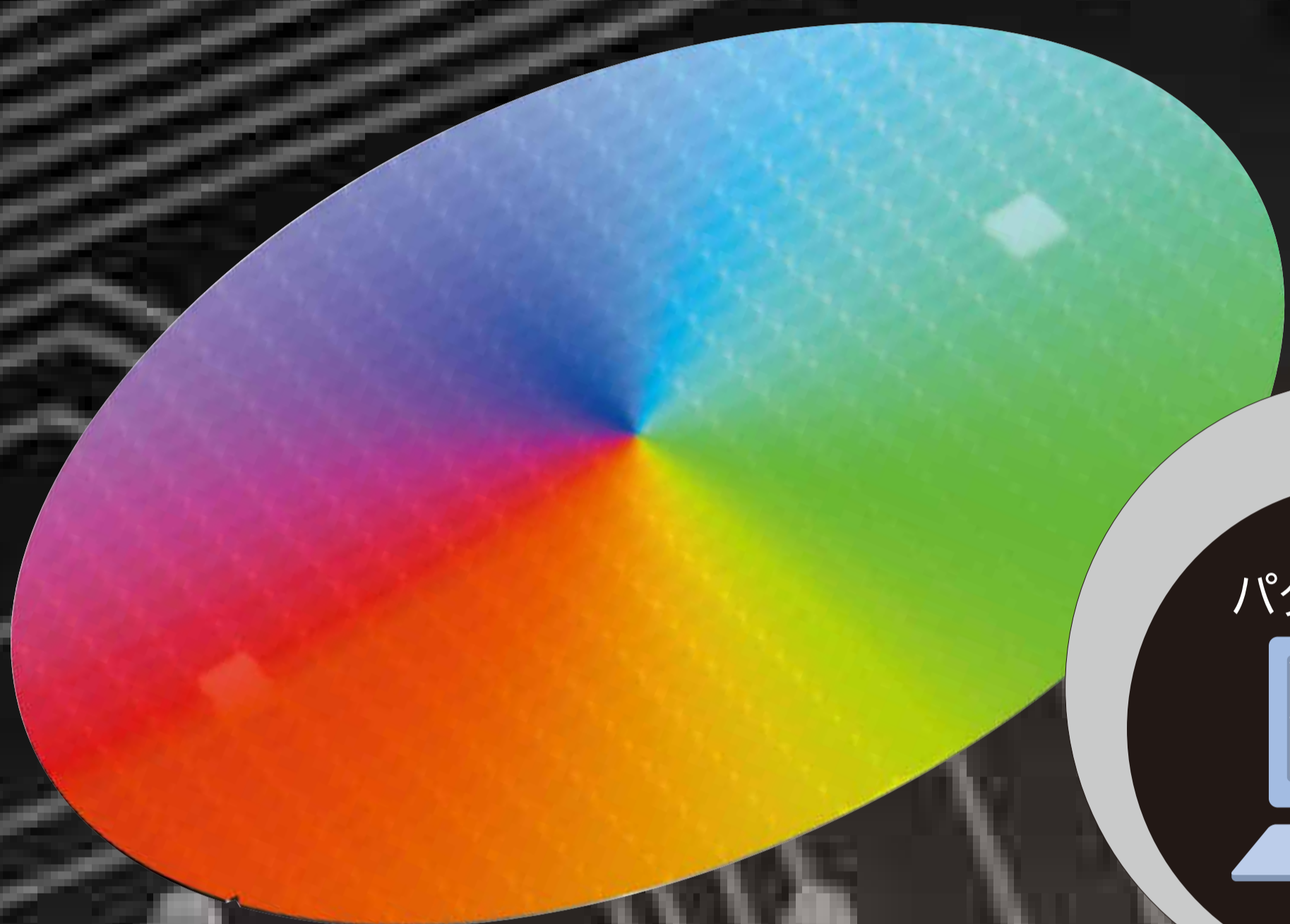


HORIBA

Semiconductor

半導体プロセスの理想形を
トータルに創造する
先進の分析システム





● レティクル/マスク
異物検査装置
PD Xpation

露光工程



● 差圧式
マスフローモジュール
CRITERION D700



● サーマル式
マスフローモジュール
SEC-Z700S



● キャパシタンス
マノメータ
VG-500



● 液体材料
気化システム
LF-F/MV-2000



● プラズマ
発光モニタ
EV 2.0 Series

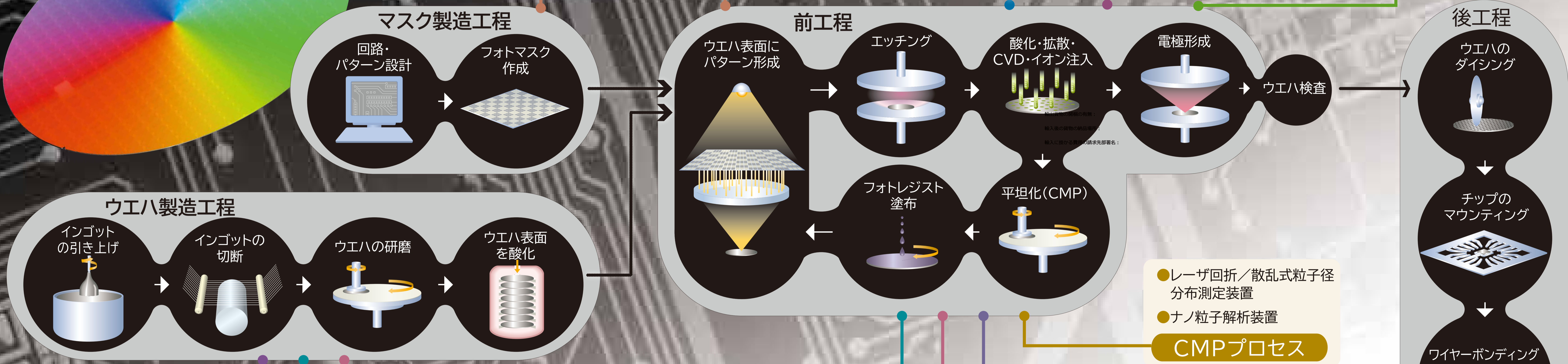


● ガスモニタ
IR-400

流体計測・制御 / 真空計測・分析(ドライプロセス)

● 工業用pH計
排水分析

● 自動薄膜計測装置 ● 紫外可視エリプソメータ
計測 / エッチング制御 / 薄膜分析



素材解析

- PL測定装置
- カソードルミネッセンス測定システム

素材解析(微粒子分析、欠陥解析)

- エネルギー分散型X線分析装置
- 顕微レーザーラマン分光測定装置
- グロー放電発光分析装置 ● X線分析顕微鏡

薬液プロセス(ウェットプロセス)

クリーンルーム内雰囲気監視

- クリーンルーム内雰囲気ガスモニタ

純水プロセス(ウェットプロセス)

- 高感度シリカモニタ ● 溶存酸素モニタ
- シリカ分析装置 ● 超純水用比抵抗計




● 全自動薄膜検査装置
Xtrology



● 非接触薬液濃度モニタ
CS-900



● 光ファイバ式
熱リン酸濃度モニタ
CS-620F



● 内部液循環式
溶存酸素モニタ
HD-960LR

HORIBA

株式会社堀場製作所 〒601-8510 京都市南区吉祥院宮の東町2番地 TEL(075)-313-8121(代) <http://www.horiba.co.jp>

株式会社堀場エステック 〒601-8116 京都市 南区上鳥羽鉾立町11-5 TEL(075)-693-2312 <http://www.horiba-stec.jp>

